

HALBLEITER

Präzisionsreinigung von Prozessequipment und Werkzeugen mit Trockeneis

In der Halbleiterproduktion müssen die Verarbeitungsgeräte extrem sauber gehalten werden um Produktverunreinigungen zu vermeiden. Bei traditionellen Reinigungsmethoden treten verschiedene Schwierigkeiten auf, darunter kostspielige Produktionsausfallzeiten, die Verwendung von Chemikalien und Lösungsmitteln, die Entsorgung gefährlicher Abfälle und die Mitarbeiter werden der Gefahr durch schädliche Chemikalien ausgesetzt. Trockeneis-Präzisionsreinigung ist eine effektive Methode zur Dekontaminierung von Halbleiterherstellungsgeräten. Das umweltfreundliche Reinigungs- und Oberflächenvorbereitungsverfahren ist aggressiv genug, um Ablagerungen und Verunreinigungen schnell zu entfernen, ohne das Oberflächenmaterial zu beeinträchtigen. Trockeneis ist auf Metall, Keramik und vielen anderen Oberflächen nicht abrasiv und kann selbst in den schwierigsten Bereichen der Verarbeitungsanlage schnell alle Verunreinigungen entfernen, ohne sekundären Abfall zu erzeugen.

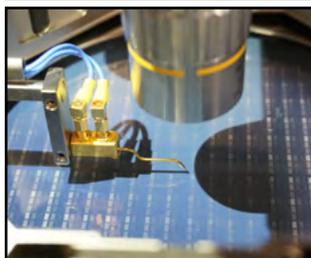
VORTEILE

- **Schnelle, effektive Reinigung**
- **Reinigung vor Ort ohne lange Demontage**
- **Nicht abrasiv, nicht brennbar, nicht leitfähig**
- **Reduktion oder Eliminierung der Benutzung von Lösungs- oder Reinigungsmitteln**
- **Niedrigere Betriebskosten**
- **Eliminierung von Schmutzeinschlüssen**
- **Sicher für die Mitarbeiter**
- **Kein Sekundärabfall**

Wafers
Masken / Schilde
Chemisch-mechanisches Polieren (CMP)
Vakuumpumpen
Entfernung konformer Beschichtung von PCB
Waferkammerwerkzeug und Komponenten

Implantierer
Stützscheiben aus Keramik
Polykristalline Silikonreaktoren
Werkzeug für die Ablagerung
Polierwerkzeug

ANWENDUNGEN



Schließen Sie sich den Branchenführern an, die bereits von Cold Jet Trockeneisreinigungssystemen profitieren.



PHILIPS

